



SVCS Process Innovation

Solutions for Semiconductor, Photovoltaic and Nanoscience Technologies

高周波多機能プラズマリアクター 研究開発用プラズマ装置

はじめに

SVCSプラズマリアクター装置は卓上型自動プロセス装置で、研究開発用途のために非常にコンパクトに設計・製造されています。成膜、エッチング、アッシングなど、研究開発に必要な各種作業に広くご利用頂けます。

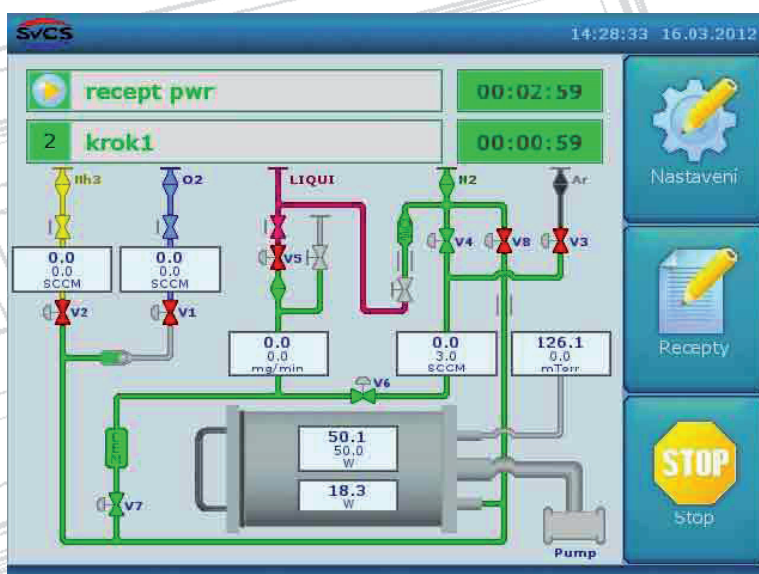
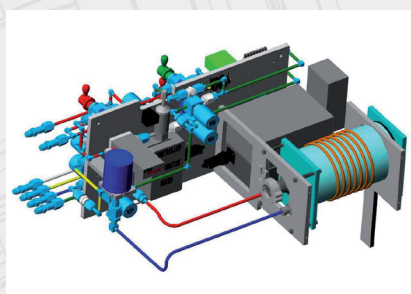
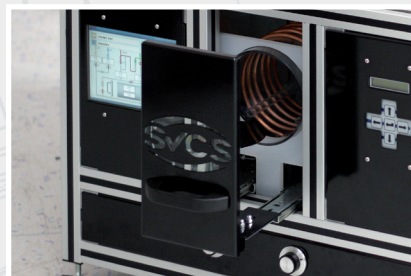
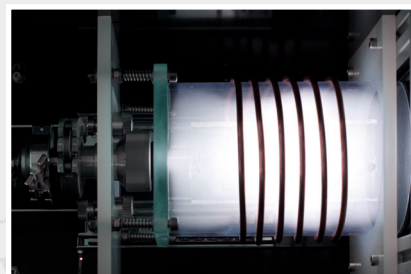
特徴

液体ソース&プロセスガス流量、真空度、温度が独立して設定できるため、多様な実験条件の設定が可能です。高性能エバポレーターも標準で備えているので通常のプロセスガスに加えて多様な液体ソースの選択ができ、供給量はマスフロー及び供給量制御装置で精密に制御します。

また、腐食性、引火性、有毒性ガスの使用に関する安全設計を徹底しており、オペレータに危険が及ばないよう出来る限りの配慮をしております。

高周波プラズマ電源は周波数および出力レベルの設定が可能で、容量結合プラズマ・誘導結合プラズマのいずれにも使用できるチューニング回路が付属しており、チャンバー内圧力もバタフライバルブまたはガスバラストシステムで制御可能です。

尚、操作用インターフェースにはタッチスクリーンを使用しており、すべてのプロセスパラメーターを自由に設定してプロセスレシピを作成することができます。





SVCS Process Innovation s.r.o.
 Optátova 37, 637 00 Brno
 CZECH REPUBLIC
 e-mail: info@svcs.eu
 http://www.svcs.eu



SVCS CO.
 330 S Pineapple Ave. S-110
 Sarasota, Florida 34236, USA
 e-mail: info@svcspi.com
 http://www.svcspi.com



Advanced Equipment MP Co. Ltd.
 2-30-4 Jyosui Minami-cho Kodaira-shi
 Tokyo, Japan 187-0021
 e-mail: saitoh@aempjp.com
 www.aempjp.com



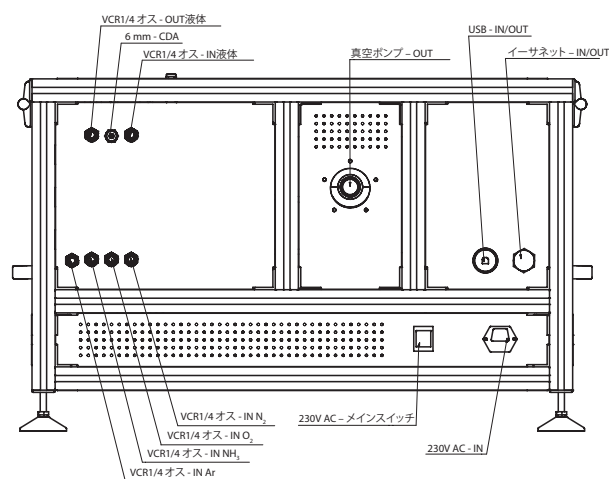
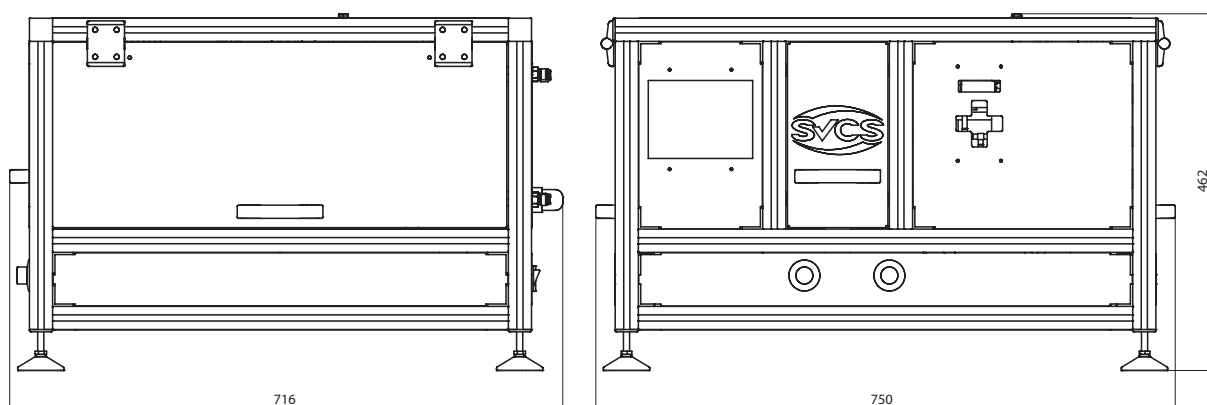
高周波多機能プラズマリアクター

仕様

仕様

チャンバーサイズ	円筒型 直径 110 mm 長さ 180 mm
温度範囲	室温(最高350℃:オプション)
圧力範囲	真空～常圧(応相談)
プロセス媒体	ガスライン: 最大5ライン、(マスフロー含む) 液体ソースライン: 1 ライン、(エバポレーターおよび供給量制御装置含む)
周波数	13.56 MHz、(40 kHz および 450 kHz:オプション)
高周波出力	100 W
オプション	ガスラインおよび液体ソースライン追加、 真空排気システムキャビネット(オーダーメイド)

トータル 設置エリア



トータル設置エリアは装置構成によって異なります。
 仕様検討後の装置レイアウト図にてご確認ください。



EUROPEAN UNION
 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND
 INVESTMENT IN YOUR FUTURE.